

**SPIE****IWAPS 国际先进光刻技术研讨会**

International Workshop on Advanced Patterning Solutions

国际先进光刻技术研讨会邀请函

International Workshop on Advanced Patterning Solutions Invitation Letter

光刻是集成电路制造领域的关键技术之一，也是衡量产业发展水平的重要指标。为了加强光刻技术领域的交流，促进业内合作，开拓研发思路，解决技术难题，推动行业发展，拟定于**2026年9月10-11日**在深圳举办“**国际先进光刻技术研讨会 (International Workshop on Advanced Patterning Solutions)**”。本次会议由中国光学学会主办。会议将聚焦先进节点的热点问题，包括设计规则、光刻方案、光刻材料、掩模、设备、量测等。本次会议仍将是一次高水平的国际技术研讨会，会议的详细信息请参见会议官网 www.iwaps.org。

本次会议的发言人来自国内外业界的顶级专家。本次会议得到了国内外知名企业、研究机构和高校的大力支持。

我们很荣幸地邀请您参加本次大会。

会议相关事项：

1. 会议时间：2026年9月10-11日，9日报到。
2. 会议地点：深圳国际会展中心（深圳市宝安区福海街道展城路1号）。
3. 注册费用：3200元/人，8月25日前注册费：2800元/人。中国光学学会光刻技术专业委员会成员2400元/人，学生1600元/人（食宿自理）。
4. 会议详情请及时登录本次会议官方网站，并请随时留意最新会议日程 (<https://www.iwaps.org/cn/index/7>) 。
5. 亦可扫描右侧二维码进行报名。

期待您的莅临！

IWAPS 组委会

